УДК 621.373.038.832

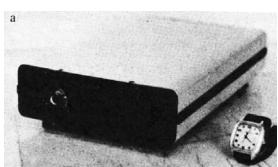
## А.И. Федоров

## ХеСІ-ЛАЗЕР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПРОДОЛЬНЫМ РАЗРЯДОМ

Исследован XeCl-лазер с продольным разрядом, работающий при низком давлении с УФ-предыонизацией в различных буферных газах (He, Ne, Ar). Выходная энергия составляла более 0,1 мДж при длительности импульса генерации 5 нс и суммарном давлении газовой смеси 45 мм рт. ст. XeCl-лазер работал также без буферного газа при E/P = 100 B/ см  $\cdot$  мм рт.ст.

В миниатюрных эксимерных лазерах в основном используется поперечный разряд для накачки [1-2], хотя продольный разряд также имеет ряд достоинств. Это простота конструкции лазерного излучателя, круглое сечение излучения и высокая степень его однородности, которая соответствует низкой расходимости излучения [3]. В [4] впервые была показана возможность применения продольного разряда для накачки эксимерных молекул. Недостатком данной системы накачки являлись низкие характеристики излучения при рабочих напряжениях более 100 кВ. В [5] была показана возможность использования продольного разряда с коронной предыонизацией за счет дополнительного фольгированного электрода. Такие системы получили название <емкостное возбуждение с продольным разрядом>, они позволили существенно увеличить энергетические характеристики излучения и уменьшить зарядные напряжения до 30–60 кВ. Так, в [6] была получена генерация на XeCl\* с энергией 0,317 мДж,  $\tau = 35$  нс при рабочем напряжении 36 кВ, давлении 520 мм рт.ст. и активной длине разряда 35 см. Кроме того, получено излучение на KrF\* без буферного газа при давлении ~300 мм рт.ст. [7]. Дальнейшее улучшение продольной системы накачки было продемонстрировано в [8], оно основано на использовании дополнительного искрового источника предыонизации. Энергия излучения соответствовала 0,1 мДж,  $\tau = 15$  нс при давлении 1,5 атм. Активная длина разряда соответствовала 26 см при зарядном напряжении 40 кВ.

В данной статье представлены результаты исследований XeCl-лазера низкого давления с дополнительным источником предыонизации в зависимости от влияния газовых компонент.





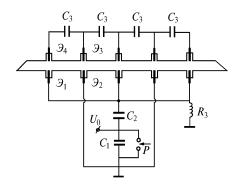


Рис. 1. б. Электрическая схема питания лазера

На рис. 1,a приведен общий вид миниатюрного лазера. На рис. 1,b представлена электрическая схема питания лазера. Использовались кварцевые трубки с внутренним диаметром 4 и 5 мм. В трубке имелось 4 лазерных промежутка с продольным возбуждением. Длина одного промежутка соответствовала 4 см. Использовалось 5 пар стальных электродов. Таким образом, разрядный канал имел общую длину 16 см и активный объем соответствовал 1,6 см $^3$ . Резонатор состоял из алюминиевого отражающего зеркала и кварцевой плоскопараллельной пластины. Схема накачки соответствовала схеме Блюмляйн. Емкости  $C_1$  и  $C_2$  изменялись от 4

до 9 нФ. Емкость  $C_3$  использовалась в качестве обострителя и источника предыонизации лазерного канала. Общая емкость  $C_3$  изменялась от 0,6 до 1,32 нФ. В качестве коммутатора использовался серийный разрядник PУ-62, что упрощает схему возбуждения и позволяет получать более высокие характеристики излучения по сравнению с тиратроном [9]. При срабатывании разрядника P происходит инверсия напряжения емкости  $C_1$  и быстро возрастающий высоковольтный импульс прикладывается к парам электродов  $Э_1$ — $Э_4$ ,  $Э_2$ — $Э_3$  через обострительную емкость  $C_3$ . После пробоя этих промежутков, которые обеспечивают ионизацию газа, одновременно происходит зарядка обострительной емкости  $C_3$  через разряды предыонизации. После ее зарядки до пробойного напряжения между электродами  $Э_3$ — $Э_4$  происходит основной продольный разряд вдоль оси трубки. При соответствующих условиях наблюдается также разряд между электродами  $Э_1$ — $Э_2$ . Следовательно, срабатывают одновременно все четыре продольных промежутка. При выборе режима работы можно использовать искровую или коронную предыонизацию. Эксперименты проводились в газовых смесях Не (Ne, Ar): Xe: HCl. Характеристики излучения регистрировались с помощью калориметра ИМО—2H, фотодиода  $\Phi$ ЭК—22 СПУМ и осциллографа C8—14.

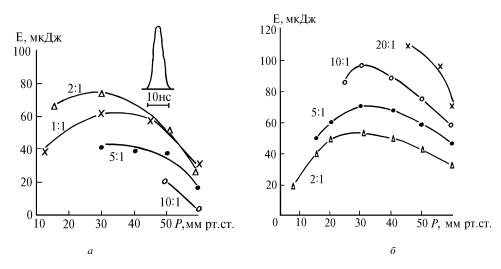


Рис. 2. Зависимости энергии излучения от соотношения Xe:HCl, суммарного рабочего давления для буферного газа Не при  $U_0$  = 12 кВ и концентрации HCl = 4; 2 мм рт.ст. – a и  $\delta$  соответственно. Импульс генерации XeCl-лазера – a

На рис. 2, a приведен импульс генерации XeCl—лазера, его длительность на полувысоте 5 нс. Кроме того, даны зависимости энергии излучения от различных соотношений Xe:HCl = N:1 и суммарного рабочего давления смеси при постоянной концентрации HCl. В качестве буферного газа использовался He. С увеличением концентрации Xe энергия излучения уменьшается. Оптимальное соотношение компонент Xe:HCl = 2:1. При низких давлениях экспериментальные результаты ограничены содержанием основных компонентов Xe и HCl. Увеличение содержания He также уменьшает энергию излучения.

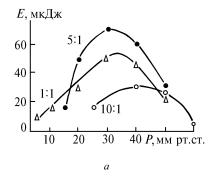
На рис. 2,  $\delta$  приведены аналогичные зависимости при концентрации HCl, равной 2 мм рт.ст. В данном случае с ростом соотношения Xe:HCl энергия излучения резко возрастает. Увеличение содержания буферного газа Не также уменьшает энергию излучения. Оптимальное соотношение компонентов Xe:HCl = 20:1. Максимальная энергия излучения достигала 110 мкДж в смесях практически без буферного газа Не, а пиковая мощность 20 кВт.

Отметим, что ранее в поперечном разряде в смесях  $Xe:CCl_4 = 400:1$  наблюдалась слабая генерация при давлениях 0,1-0,6 атм [10]. Следовательно, для продольного разряда с интенсивным источником предыонизации существенную роль играет концентрация HCl в газовой смеси, а сопротивление плазмы определяется в основном лишь концентрацией Xe и HCl. Резкое отличие в соотношениях Xe:HCl для малых и больших концентраций HCl, видимо, связано

с механизмом образования молекул XeCl\* (рис. 5,6). Из рис. 2,a,6 следует, что оптимальное давление рабочих смесей  $\sim$ 30 мм рт.ст.

На рис. 3, a приведены зависимости энергии излучения от Xe:HCl=N:1 и суммарного давления смеси с буферным газом Ar. При больших концентрациях HCl разряд был менее однороден. Оптимальное соотношение соответствовало Xe:HCl=5:1, а давление смеси 30 мм рт. ст. Максимальная энергия излучения равнялась 70 мкДж за импульс. С Ar наблюдаются более выраженные оптимумы по рабочему давлению.

На рис. 3,  $\delta$  даны зависимости энергии излучения в смесях с буферным газом Ne. Оптимальное соотношение Xe:HCl = 5:1, а давление смеси соответствует 30 мм рт.ст. Максимальная энергия излучения равнялась 60 мкДж за импульс.



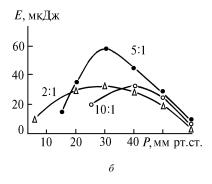
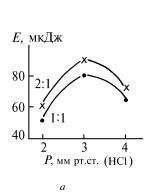


Рис. 3. Зависимости энергии излучения от соотношения Xe:HCl, суммарного рабочего давления для буферных газов Ar (a), Ne ( $\delta$ ) при  $U_0=12$  кВ и HCl = 2 мм рт.ст.

Таким образом, в продольном разряде с дополнительным источником питания более высокие характеристики излучения достигаются с буферным газом Не или без него. Данные результаты, видимо, обусловлены высокими  $E/P = 100 \text{ B/cm} \cdot \text{мм}$  рт. ст., где буферный газ не играет существенной роли по сравнению с лазерами с поперечной накачкой [11, 12].



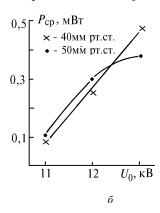
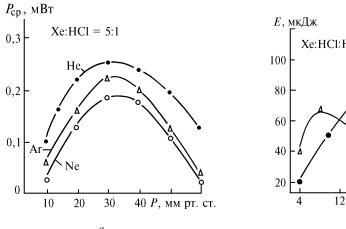


Рис. 4. Зависимости энергии излучения от концентрации HCl с буферным газом He и от различных соотношений Xe:HCl при  $U_0 = 12$  кВ (a) и зависимости средней мощности излучения от зарядного напряжения, суммарного давления смеси при f = 5  $\Gamma$ ц, Xe:HCl = 5:1 (2 мм рт.ст.)  $(\delta)$ 

На рис. 4, a даны зависимости энергии излучения в смесях с буферным газом Не от соотношения Xe:HCl и концентрации HCl. С увеличением содержания Xe энергия излучения возрастает, а для HCl наблюдается оптимум, который соответствует 3 мм рт.ст., аналогичный поперечному разряду [11]. При уменьшении концентрации HCl энергия излучения, видимо, падает из-за выгорания HCl в активном объеме при низких рабочих давлениях и высоком E/P. При высокой концентрации HCl наблюдается контракция разряда. Экспериментальные данные подтверждают жесткую связь между согласованием волнового сопротивления разрядной плазмы с источником питания (рис. 4,  $\delta$ ). Это зависимости средней мощности излучения с буферным газом Не при f = 5  $\Gamma$ ц от энергии, вкладываемой в разряд (от зарядного напряжения),

и суммарного давления смеси (сопротивление плазмы разряда). Отметим, что с ростом зарядного напряжения линейно растет выходная мощность излучения и достигает 0,47 мВт. Кроме того, с ростом суммарного давления смеси снижается выходная мощность излучения независимо от буферного газа (рис. 5, а). Максимальная средняя мощность достигается с Не, оптимальное рабочее давление соответствует 30 мм рт.ст. На рис. 5,  $\delta$  приведены зависимости энергии излучения для смесей Xe:HCl:He = N:1:1 от концентрации Xe и HCl = 2; 4 мм рт.ст. при  $U_0$  = 12 кВ. Практически при низких содержаниях НСІ роль буферного газа, видимо, играет Хе.



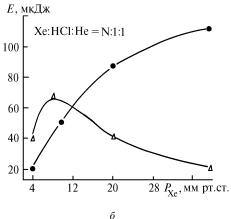


Рис. 5. Зависимости средней мощности излучения от суммарного рабочего давления смеси с буферными газами Ar, Ne, He при f = 3  $\Gamma$ ц,  $U_0$  = 12 кB, Xe:HCl = 5:1 (2 мм рт.ст.) (a) и зависимости энергии излучения для смесей Xe:HCl:He = N:1:1 от концентрации Xe при  $U_0$  = 12 кB, HCl = 2 мм рт.ст. ( $\bullet$ ); 4 мм рт.ст. ( $\Delta$ ) ( $\delta$ )

В заключение отметим основные результаты работы.

- 1. Проведены исследования XeCl-лазера низкого давления, в котором в качестве буферных газов используются Не, Ne, Ar. Более высокие характеристики излучения наблюдаются с Не.
- 2. Получена генерация на XeCl\* с продольным разрядом без буферного газа при  $E/P = 100 \text{ B/cm} \cdot \text{mm pt.ct.}$
- 3. Проведенные эксперименты показали возможность создания эффективных миниатюрных эксимерных лазеров низкого давления с УФ-предыонизацией при низких зарядных напряжениях 10–13 кВ.

```
1. Sre R.C., Seegmiller E. //IEEE J. Quant. Elect. 1981. V. QE-17. №1. P. 81-91.
```

- 2. Yamada K., Miyazaki K., Hasama T., Sato T.//IEEE J. of Quant. Elect. 1988. V. QE-24. №2. P. 177–182.
- 3. Furuhashi H., Goto Т. //Rev. Sci. Instrum. 1988. V. 59. №12. Р. 2552—2556. 4. Исаков И.М., Леонов А.Г., Оглуздин В.Е. // Письмав ЖТФ. 1977. Т. 3. Вып. 18. С. 965—968.
- 5. Newman L.A. //Appl. Phys. Lett. 1978. V. 33. №6. P. 501–503.
- 6. Zhou Z., Zeng Y., Qiu M. // Appl. Phys. Lett. 1983. V. 43. №4. P. 347–349.
- 7. Rosa J. de la and Eichler H. J. // Optics Communications. 1987. V. 64. №3. P. 285–287.
- 8. Furuhashi H., Hiramatsu M., Goto T. // Appl. Phys. Lett. 1987. V. 50. №14. P. 883-885.
- 9. Головин Ю.Ф., Дымшиц Ю.И., Ершов Л.С. идр. // ОМП. 1984. №2. С. 35–38. 10. Зубрилин Н.Г., Миланич А.И., Черноморец М.П. идр.//Квантовая электроника. 1985. Т. 12. N 3. C. 643-644.
- 11. Федоров А.И., Бричков С.А.//Оптика атмосферы. 1989. Т. 2. №6. С. 772–775.
- 12. Федоров А.И., Мельченко С.В.//ЖТФ. 1990. Т. 60. Вып. 4. С. 105–110.

Институт оптики атмосферы СО РАН, Томск

Поступила в редакцию 17 июня 1993 г.

## A . I . Fedorov. Low-Pressure XeCl Laser with Excitation by a Longitudinal Electric Discharge.

This paper presents a study of a XeCl laser operated in low pressure longitudinal electric discharge with a UVpreionization and in gas mixtures with different buffer gases (He, Ne, and Ar). At a pressure of 45 Torr the output energy of 0,1 mJ per pulse at a pulse duration of 5 ns was obtained. The lasing effect has also been observed without any buffer gas at the ratio E/P = 100 V/cm Torr.